

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【公表番号】特表2004-509989(P2004-509989A)

【公表日】平成16年4月2日(2004.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-013

【出願番号】特願2002-529170(P2002-529170)

【国際特許分類】

C 08 F 4/00 (2006.01)

C 08 F 2/38 (2006.01)

【F I】

C 08 F 4/00

C 08 F 2/38

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月9日(2008.9.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

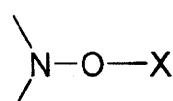
【特許請求の範囲】

【請求項1】

a) 少なくとも一種のエチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーと、

b 1) 構造要素：

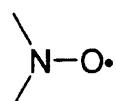
【化1】



[式中、Xは少なくとも一つの炭素原子を有する基を表し、そしてXから誘導された遊離ラジカルX・はエチレン性不飽和モノマーの重合を開始できる。]を有する少なくとも一種のニトロキシルエーテル、または

b 2) 少なくとも一種の安定な遊離ニトロキシルラジカル：

【化2】



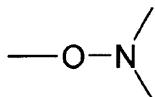
および遊離ラジカル開始剤と、

c) メルカプタン、チオエーテルおよびジスルフィドからなる群より選択される連鎖移動剤とを含む重合性組成物（但し、安定な遊離ニトロキシルラジカルが存在する場合、連鎖移動剤はジスルフィドでない。）。

【請求項2】

a) ニトロキシルラジカルまたはニトロキシルエーテルの存在下でのラジカル重合により生成され、かつオリゴマー／ポリマー骨格に結合されて構造要素：

【化3】



を持つニトロキシリル基を有するオリゴマーまたはポリマーである高分子性開始剤と、

b) エチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーと、

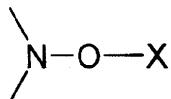
c) メルカブタン、チオエーテルおよびジスルフィドからなる群より選択される連鎖移動剤とを含む重合性組成物。_____

【請求項 3】

少なくとも一種のエチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーの遊離ラジカル重合によりオリゴマー、コオリゴマー、ポリマーまたはコポリマー（ブロック型、ランダム型またはグラフト型）を生成する方法であって、モノマーまたはモノマー／オリゴマーを、

b 1) O - X 結合の分断を為して二つの遊離ラジカルを形成でき、ラジカル X · は重合を開始できる反応条件下で構造要素：

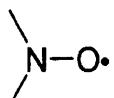
【化 4】



を有する少なくとも一種のニトロキシリルエーテル、または

b 2) 少なくとも一種の安定な遊離ニトロキシリラジカル：

【化 5】



および遊離ラジカル開始剤と、

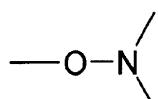
c) メルカブタン、チオエーテルおよびジスルフィドからなる群より選択される連鎖移動剤との存在下で（共）重合することからなる方法（但し、安定な遊離ニトロキシリラジカルが存在する場合、連鎖移動剤はジスルフィドでない。）。

【請求項 4】

遊離ラジカル重合によりブロック（コ）ポリマーを生成する方法であって、

a) ニトロキシリラジカルまたはニトロキシリルエーテルの存在下でのラジカル重合により生成され、かつオリゴマー／ポリマー骨格に結合されて構造要素：

【化 6】



を持つニトロキシリル基を有するオリゴマーまたはポリマーである高分子性開始剤と、

b) エチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーとを、

c) メルカブタン、チオエーテルおよびジスルフィドからなる群より選択される連鎖移動剤の存在下、O - ポリマー結合の分断を為して二つの遊離ラジカルを形成でき、ポリマーラジカル（高分子性開始剤）が重合を開始できる反応条件下で（共）重合することからなる方法。_____